シリコンナノワイヤを用いたトランスバース型マイクロ TEG モジュールの完全最適設 計とその性能

Fully optimized design and performance of transverse-type micro-TEG modules using Si-nanowires 東工大未来研 °熊谷 颯人, 塩津 勇作, 遠藤 弘之, 菅原 聡

H. Kumagai, Y. Shiotsu, H. Endou, and S. Sugahara, FIRST, Tokyo Inst. of Tech. E-mail: h.kumagai@isl.titech.ac.jp

【はじめに】近年、医療・介護・ヘルスケアを対象とした Internet of Humans (IoH)が注目を集めている[1]. IoH において、ウェアラブルデバイス(WD)は重要な Man-Machine Interface として期待されている. 我々 は、このような WD に応用できるヒトの体温を用いた熱電発電の検討を進めている[2-4]. 前回の発表では、 熱電材料としてシリコンナノワイヤ(Si-NW)を用いたトランスバース型µTEG モジュールについて報告した [5]. 今回はこのµTEG モジュールの完全最適設計とその性能について報告する.

【モジュール構造】図1にSi-NWを用いたトランスバース型µTEGとモジュールの構造を示す.µTEG部はSi-on-insulator(SOI)基板上の超薄膜Si層を微細加工してSi-NW列を作製する(図1(a)および(b)). µTEG部のサイズは $D_0 \times L$ である(µTEG部の長辺 D_0 が長いときは、図1(c)のように適当に折り曲げて集積化する). このµTEG チップを真空/絶縁体ハイブリッドアイソレーションのモジュールにマウントする(図1(c)および(d)). 大気中への放熱を確保するために必要となるモジュールの表面積が $D \times D$ である. 最適化する構造パラメータは D_0 , x, H, (1- γ)d, γ d, mo, N_{NW}, tc である(図1参照). 各パラメータはそれぞれ, µTEG部の長辺,支持構造(高降伏強度絶縁材料)の幅と高さ,引き出し電極の幅,Si-NWの長さ,直列数,並列数,引き出し電極の長さである. 構造最適化にはSi-NWとメタルコンタクトとの間に生じる熱的・電気的寄生抵抗も考慮した[3]. また, µTEG チップ内の熱的・電気的絶縁にポーラスシリカ(PS)を用いた. 最適設計にはヒトの産熱限界を考慮した恒温動物モデルを用いた[3,4]. モジュールサイズをD=1cmとし,体温と外気との温度差は ΔT_0 =10Kとした.

【設計結果と性能評価】前回報告したように tc がyd 程度の場合, (1-y)d を固定し, 簡略化した設計アルゴ リズムを用いても十分に最適設計が可能である[5]. tc を伸ばすことはモジュールの出力電力 Pout の増大 に効果的であるが, この場合, この簡略アルゴリズムの適応には限界がある. そこで, モジュールの構造 を完全に最適化できるアルゴリズムを用いて tc の効果を詳細に調べた. 図 2 に各種構造パラメータと Pout の tc 依存性を示す. この図の横軸の各点で Pout が最大になるように各構造パラメータを最適化してある. tc の増加とともに各構造パラメータが変化し, Pout が増加する. Si-NW を用いたトランスバース型μTEG モ ジュールの高出力化には tc の増加が重要であるが, このとき TEG 部の最適構造(ナノワイヤの長さ, 直列 数, 並列数, および引き出し電極幅)は tc に強く依存して変化する.

【参考文献】[1] A.M. Ionescu, 63rd IEEE Int. Electron. Dev. Meeting, p 1.2, 2017. [2] T. Kondo *et al.*, 2017 IEEE Electron. Dev. Tech. and Manufact. Conf. pp 201-203. [3] 清野他, 第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 18p-G203-3, 2018. [4] N. Chiwaki *et al.*, J. Micromech. Microeng. **28**, 094003, 2018. [5] 熊谷他, 第 80 回応用物理学会秋季学術講演会, 19a-E307-2, 2019.



図 1. 薄膜トランスバース型µTEG とモジュール構造

図 2. 各種パラメータの tc 依存性